PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 C07D 319/06, C07C 253/14, 255/20 // C07B 61/00

(11) 国際公開番号

WO99/57109

(43) 国際公開日

1999年11月11日(11.11.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/02272

A1

(81) 指定国 CA, CN, HU, IN, JP, NO, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

(22) 国際出願日

1999年4月28日(28.04.99)

(30) 優先権データ

特願平10/121135

1998年4月30日(30.04.98) JP 添付公開書類

国際調查報告告

請求の範囲の補正の期限前の公開;補正費受領の際には再公 開される。

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 鐘淵化学工業株式会社(KANEKA CORPORATION)[JP/JP] 〒530-8288 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

満田 勝(MITSUDA, Masaru)[JP/JP]

〒674-0092 兵庫県明石市二見町東二見643-1-1404 Hyogo, (JP)

宮崎真人(MIYAZAKI, Makoto)[JP/JP]

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目9-25-404 Hyogo, (JP)

井上健二(INOUE, Kenji)[JP/JP]

〒675-0039 兵庫県加古川市加古川町栗津82-501 Hyogo, (JP)

(74) 代理人

安富康男, 外(YASUTOMI, Yasuo et al.)

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中岛5丁目14番22号

リクルート新大阪ビル4階 Osaka, (JP)

PROCESS FOR PRODUCING 6-CYANOMETHYL-1,3-DIOXANE-4-ACETIC ACID DERIVATIVES (54)Title:

(54)発明の名称 6ーシアノメチルー1,3ージオキサンー4ー酢酸誘導体の製造方法

(57) Abstract

A process whereby 6-cyanomethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid derivatives, which are important intermediates of an HMG coenzyme A reductase atorvastatin, can be industrially, easily and efficiently produced. This process comprises starting with a 3,5-dihydroxy-6halohexane derivative, treating it with a cyaniding agent to thereby substitute the halogen atom with the cyano group (i.e., a cyanation reaction) and forming an acetal of a diol by using an acetal-forming agent in the presence of an acid catalyst (i.e., an acetal-formation reaction).

BEST AVAILABLE COPY

(57)要約

HMG補酵素A還元酵素阻害剤アトロバスタチンの重要中間体である6-シアノメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体を工業的に安易かつ効率的に製造することを可能にする製造方法であって、3, 5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体を出発原料として、シアノ化剤を作用させてハロゲン原子をシアノ基に置換するシアノ化反応、及び、酸触媒存在下でアセタール形成反応剤を用いるジオールのアセタール形成反応を行う、6-シアノメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体の製造方法。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

```
AE 797首長国連邦 DM ドミニカ KZ カザフスタン RU ロシア AL アルバニア EE エストニア LC セントルシア SE スーダン AT オーストリア FI フィンランド LK スリ・ランカ SG シンロヴェキア AZ アゼルバジェア FR フランス LR リベリア SI スロヴェキア BA ボニア・ヘルツェゴビナ GB 英国 LT リトアニア SL シェラルト BE ベルギー GD グルジア LV ラトヴェア SZ スロヴェキア BB バルバドス BC グルジア LV フトセンブイグ SN をオラジル BC ブルガリア GM ガンビア MC モナコ TG トラージド BC ブルガリア GM ガンビア MC モナコ TG トラージー TT トルジューク TT クランド TT クランド TT クランド MC マグバニア TT クランド TT クラント TT トルコ アウブング TT トルコ アウブングエーフリカ 共和国 TT トアウブング TT トルコ アウブング TT トルコ アウブングエーフリカ 共和国 TT トアウブング TT トルトコ アウブングエーフリカ 共和国 TT トアウブングエーフリカ 共和国 TT トアウブングエーフリカ 共和国 TT トアウブングエーフリカ TT トアウブンド TT トアウブン TT トアウブンド TT トアウブン TT トアウブン TT トアウブン TT トアウブン TT トアウブン TT トアウブン TT トアウ
```

WO 99/57109 PCT/JP99/02272

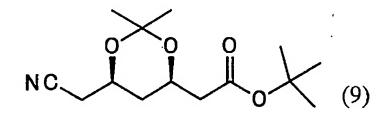
明細書

6-シアノメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体の製造方法

5 技術分野

本発明は医薬品中間体、特に、HMG補酵素A還元酵素阻害剤アトロバスタチン(国際公開第93/07115号パンフレットに記載)の製造における重要中間体である(4R, 6R) -6-シアノメチル-2, 2-ジメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸1, 1-ジメチルエチル(式(9)):

10



15 等を製造することができる、6 - シアノメチル-1, 3 - ジオキサン-4 - 酢酸 誘導体の製造方法に関する。

背景技術

従来、(4R, 6R) -6-シアノメチル-2, 2-ジメチル-1, 3-ジオ 20 キサン-4-酢酸1, 1-ジメチルエチル(式(9))の製造方法として、国際 公開第89/07598号パンフレットには、イソアスコルビン酸から製造する 方法と光学活性エポキシドから製造する方法とが開示されている。しかし、いず れの方法も、工業的に入手可能な原料から製造しようとすると、工程数が多くな りすぎ煩雑である。

25 米国特許第5103024号明細書には、(4R-シス)-1,1-ジメチル エチル6-ヒドロキシメチル-2,2-ジメチル-1,3-ジオキサン-4-ア セテートを出発物質とし、アリールスルホネートへの変換及びシアノ化を経て、 2段階で目的物に誘導する方法が開示されている。しかし、ここで用いられてい る出発物質は高価であり、出発物質自身を工業的に入手可能な原料から製造しよ うとすると、多段階の合成プロセスを必要とする。

米国特許第5155251号明細書には、(S)-4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エステルをシアノ化し、酢酸 t e r t - プチルエステルから誘導されるエノレートアニオンを反応させ(<math>5 R)-1, 1- ジメチルエチル-6-シアノー5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサノエートを得、次いでケトンカルボニル基をハイドライドで立体選択的に還元し、引き続き1, 3-ジオールをアセトニドとして目的物を製造する方法が開示されている。

国際公開第97/00968号パンフレットには、(5R)-1,1-ジメチルエチルー6-シアノー5-ヒドロキシー3-オキソヘキサノエートのケトンカルボニル基を微生物により立体選択的に還元し、引き続き1,3-ジオールをアセトニドとして目的物を製造する方法が開示されている。

しかし、米国特許第5155251号明細書及び国際公開第97/00968号パンフレットに記載の製造方法に共通して使用する(5R)-1, 1-ジメチルエチル-6-シアノ-5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサノエートは、米国特許第5155251号明細書に記載の方法で製造されるが、このときの(S)<math>-4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エステルのシアノ化反応において、好ましくない副反応、すなわち反応条件下で生成するエポキシド由来の副反応(J. Org. Chem., 32(1967), p. 3888)の進行により、反応収率及び生成物の純度が低下することが本発明者らの考察により明らかとなった。

20 本発明は、上記に鑑み、医薬品中間体として有用である、一般式(3);

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & R^3 \\
0 & 0 \\
0 & 0
\end{array}$$

$$OR^1 \qquad (3)$$

25

15

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数 $1\sim 12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 10$ のアリール基又は炭素数 $7\sim 12$ のアラルキル基のいずれかを表す。) で表される 6-シアノメチルー1, 3-ジオキサンー4-酢酸誘導体、及び、これらの光学活性体を、工業的に入手容易な原料から、安価か

つ高収率で製造する方法を提供することを目的とする。

発明の要約

本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、工業的に入手可能 な4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エステルから、公知の方法等を用いて2段階 で収率よく製造できる、一般式(1);

$$X \longrightarrow OH OH O$$

$$OR^1 (1)$$

10

(式中、 R^1 は、水素原子、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 0 のアリール基又は炭素数 $7\sim 1$ 2 のアラルキル基のいずれかを表す。 X は、ハロゲン原子を表す。)で表される 3 、5 - ジヒドロキシー 6 - ハロヘキサン酸誘導体を出発物質として、一般式(3);

15

25

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & R^3 \\
O & O \\
O & O \\
O & R^1 \\
\end{array} (3)$$

20 (式中、 R^1 は上記に同じ。 R^2 , R^3 は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数 $1\sim12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim10$ のアリール基又は炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される 6-シアノメチル-1, 3-ジオキサン-4-m酸誘導体を、2段階で効率よく製造できる方法を開発するに至った。

すなわち本発明は、上記一般式(1)で表される3,5ージヒドロキシー6ーハロヘキサン酸誘導体に対して、シアノ化剤を作用させてハロゲン原子をシアノ基に置換するシアノ化反応、及び、酸触媒存在下でアセタール形成反応剤を用いるジオールのアセタール形成反応を行う、上記一般式(3)で表される6ーシアノメチルー1,3ージオキサンー4ー酢酸誘導体の製造方法である。

当該製造方法は、上記一般式(1)で表される3.5-ジヒドロキシー6-ハ

WO 99/57109

4

PCT/JP99/02272

ロヘキサン酸誘導体と、シアノ化剤との反応により、一般式(2);

$$NC$$

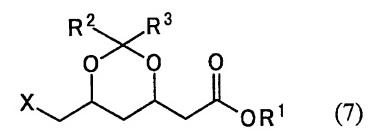
$$OH OH O$$

$$OR^1 (2)$$

5

(式中、 R^1 は上記に同じ。)で表される6-シアノ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体を得た後に、酸触媒条件下、アセタール形成反応剤によりアセタール形成反応を行うことにより達成され、また、

上記一般式(1)で表される3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体 を、酸触媒条件下、アセタール形成反応剤によりアセタール形成反応を行い、一般式(7);



15

(式中、 R^1 , R^2 , R^3 , Xは上記に同じ。) で表される6-ハロメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体を得た後に、シアノ化剤によりシアノ化することによっても達成される。

20

特に、本発明者らは、上記一般式(1)で表される3,5-ジヒドロキシ-6 -ハロヘキサン酸誘導体にシアノ化剤を反応させることで進行するXの置換反応が、Xに隣接する水酸基の隣接基効果で極めて効果的に進行し、その結果、上記一般式(2)で表される6-シアノ-3,5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体を効率よく製造できることを新しく見出した。

25

また、出発物質に光学活性な 3, 5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体を使用すると、個々の不斉中心の立体配置を保持したまま、光学活性な <math>6-シ アノー 3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体、及び、光学活性な <math>6-シ アノー 1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体を製造できることも、本発明者らによって見出された。

5

以下に本発明を詳述する。

発明の詳細な開示

下記のスキーム1に示されているように、3, 5-ジヒドロキシ-6-ハロへ キサン酸誘導体(1)から6-シアノメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体(3)を製造するための2種類のルートが、本発明者らによって見出された。

第1のルートは、3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体(1)をシアノ化剤によりシアノ化し(工程(I))、得られる6-シアノ-3,5-ジとドロキシヘキサン酸誘導体(2)を、酸触媒下、アセタール形成反応剤によりアセタール形成し(工程(II))、6-シアノメチル-1,3-ジオキサン-4-酢酸誘導体(3)を製造する方法(以下、ルートAという)である。

第2のルートは、3,5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体(1)に、酸触媒下、アセタール形成反応剤によりアセタール形成し(工程(III))、

WO 99/57109 PCT/JP99/02272

得られる6-ハロメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体(7)を、シアノ化剤によりシアノ化して(工程(IV))、6-シアノメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体(3)を製造する方法(以下、ルートBという)である。本発明のルートA及びルートB共通の出発物質である、一般式(1):

5

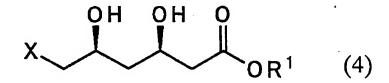
$$X \xrightarrow{OH OH O} OR^1$$
 (1)

で表される 3, 5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体において、 R^1 は 10 水素原子、炭素数 $1\sim12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim10$ のアリール基又は炭素 数 $7\sim12$ のアラルキル基のいずれかである。

上記炭素数 1~12のアルキル基、炭素数 6~10のアリール基、炭素数 7~12のアラルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、1,1-ジメチルエチル基、ヘキシル基、ドデカニル基、フェニル基、トリル基、ナフチル基、ベンジル基、p-メトキシベンジル基、ナフチルエチル基等が挙げられる。好ましくは、1,1-ジメチルエチル基である。

Xは、ハロゲン原子であり、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられる。より好ましくは、塩素原子である。

なお、3,5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体(1)は、2つの不20 斉炭素を有するキラル化合物であり、(3S,5S)-体、(3S,5R)-体、(3R,5S)-体、(3R,5R)-体の4つの光学異性体が存在するが、本発明においては、これらすべての光学活性体を使用することができる。また、これらの複数の異性体からなる混合物の3,5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体(1)を使用することもできる。好ましくは、下記一般式(4)で表される(3R,5S)-体の光学活性体である。



PCT/JP99/02272 WO 99/57109

従って、最も好ましい3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体(1) は、(3R, 5S) - 6 - 0ロロ-3, 5 - 3ヒドロキシヘキサン酸1、1 - 1ジメチルエチルである。

なお、3.5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体(1)は、工業的に 入手可能な4-クロロー3-ヒドロキシ酪酸エステルから、公知の方法等を用い て2段階で収率よく製造できる。例えば、(3R, 5S) -6-クロロ-3.5 -ジヒドロキシヘキサン酸1,1-ジメチルエチルは、大量生産可能な(S)-4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エステル (例えば、特許第1723728号明 細書)から、例えば、米国特許第5278313号明細書の方法により、下記の スキーム2に示される方法で製造できる。 10

a) CH₃CO₂t-Bu/LHMDS/THF, b) AcOH,

15

20

c) Et₂BOMe/NaBH₄/THF, d) H₂O₂

本発明ルートAの工程(I)において、シアノ化剤としては、青酸塩が使用で きる。上記青酸塩としては、例えば、シアン化ナトリウム、シアン化カリウム、 シアン化カルシウム、シアン化銀、シアン化テトラエチルアンモニウム、シアン 化テトラブチルアンモニウム等が挙げられる。好ましくはシアン化ナトリウム又 はシアン化カリウムである。

本発明ルートAの工程(I)において使用するシアノ化剤の使用量は、3,5 ージヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体(1)に対し、好ましくは1~5モ ル当量であり、より好ましくは1~2モル当量である。

本発明ルートAの工程 (I) において、使用できる溶媒としては、例えば、水、有機溶媒が挙げられる。上記有機溶媒として、例えば、メタノール、エタノール、ブタノール、イソプロピルアルコール、エチレングリコール、メトキシエタノール等のアルコール系溶媒;ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メチル tープチルエーテル、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒;酢酸エチル、酢酸プチル等のエステル系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム、1,1,1ートリクロロエタン等のハロゲン系溶媒;ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル等の含窒素系溶媒;ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられる。上記溶媒は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記溶媒においては、水、ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン等が好ましい。

5 本発明ルートAの工程(I)の反応温度は、0℃から150℃、好ましくは20℃から100℃である。

本発明ルートAの工程(I)の反応時間は、反応条件によって異なるが、数分~10時間である。

反応終了後、反応液から生成物を取得するためには、一般的な後処理を行えば よい。例えば、反応終了後の反応液に水を加え、一般的な抽出溶媒、例えば酢酸 エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を用いて抽出 操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒及び抽出溶 媒を留去すると、目的物が得られる。また、反応終了後、直ちに減圧加熱等の操 作により反応溶媒を留去してから同様の操作を行ってもよい。このようにして得 られる目的物は、ほぼ純粋なものであるが、晶析精製、分別蒸留、カラムクロマ トグラフィー等一般的な手法により精製を行い、さらに純度を高めてもよい。

本発明ルートAの工程(I)によって得られる、一般式(2);

WO 99/57109 PCT/JP99/02272

$$NC$$

$$OH OH O$$

$$OR^1 (2)$$

5 で表される6-シアノ-3,5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体の2つの不斉炭素の立体配置は、使用した3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体(1)の立体配置を保持しており、(3S,5S)-体、(3S,5R)-体、(3S,5R)-体、(3R,5S)-体、(3R,5R)-体の3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体から、それぞれ、(3S,5R)-体、(3S,5S)-体、(3R,5R)-体、(3S,5S)-体、(3R,5R)-体、(3R,5S)-体の6-シアノ-3,5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体が得られる。好ましくは、下記一般式(5)で表される(3R,5R)-体である。

$$NC \longrightarrow OH OH O OR^1 (5)$$

20

従って、最も好ましい。3、5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体(1)である(3R, 5S)-6-クロロー3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸 1, 1-ジメチルエチルから、最も好ましい6-シアノー3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体(2)である(3R, 5R)-6-シアノー3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸 1, 1-ジメチルエチルを製造することができる。

本発明ルートAの工程(II)において、アセタール形成反応剤としては特に限定されず、例えば、ケトン、アルデヒド、アルコキシアルカン、アルコキシアルケン等が挙げられる。上記ケトン、アルデヒド、アルコキシアルカン、アルコキシアルケン等の具体例としては、例えば、アセトン、シクロヘキサノン、ホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、ジメトキシメタン、2,2ージメトキシプロパン、2ーメトキシプロペン、1,1ージメトキシシクロヘキサン等が挙げられる。好ましくは、アセトン、2ーメトキシプロペン、2,2ージメトキシプロパンである。より好ましくは、2,2ージメトキシプロパンである。

本発明ルートAの工程(II)において使用するアセタール形成反応剤の使用量は、6-シアノ-3,5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体(2)に対し、好ましくは1~10モル当量であり、より好ましくは1~5モル当量である。また、反応を速やかに促進させる目的で、アセタール形成反応剤を反応溶媒として使用することができる。

本発明ルートAの工程(II)において、酸触媒としては、ルイス酸又はブレンステッド酸が使用できる。上記ルイス酸、ブレンステッド酸としては、例えば、三塩化アルミニウム、三フッ化ホウ素、二塩化亜鉛、四塩化スズ等のルイス酸;シュウ酸、ギ酸、酢酸、安息香酸、トリフルオロ酢酸等のカルボン酸;メタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、カンファースルホン酸、ピリジニウムpートルエンスルホン酸等のスルホン酸;塩酸、硫酸、硝酸、ホウ酸等の無機酸等が挙げられる。好ましくは、pートルエンスルホン酸、カンファースルホン酸、ピリジニウムpートルエンスルホン酸である。

本発明ルートAの工程(II)において使用する酸触媒の使用量は、6-シア ノー3、5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体(2)に対し、好ましくは0.00 1~0.5モル当量であり、より好ましくは0.005~0.2モル当量である。 本発明ルートAの工程(II)の反応は、無溶媒でも実施できるが、各種有機 溶媒を反応溶媒に使用してもよい。上記有機溶媒としては、例えば、ペンゼン、 トルエン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒:ジエチルエーテル、テトラヒド ロフラン、1、4 - ジオキサン、メチル t - ブチルエーテル、ジメトキシエタン 20 等のエーテル系溶媒:酢酸エチル、酢酸プチル等のエステル系溶媒:アセトン、 メチルエチルケトン等のケトン系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム、1.1. 1-トリクロロエタン等のハロゲン系溶媒:ジメチルホルムアミド、アセトアミ ド、ホルムアミド、アセトニトリル等の含窒素系溶媒;ジメチルスルホキシド、 N-メチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶 媒等が挙げられる。上記有機溶媒は、単独で用いてもよく、2種以上を併用して もよい。好ましくは、トルエン、アセトン、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、 ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル、ジメチ ルスルホキシド、N-メチルピロリドンである。

PCT/JP99/02272 WO 99/57109 11

本発明ルートAの工程(II)の反応温度は、-20℃から100℃、好まし くは0℃から50℃である。

本発明ルートAの工程(II)の反応時間は、反応条件によって異なるが、数 分~10時間である。

反応終了後、反応液から生成物を取得するためには、一般的な後処理を行えば 5 よい。例えば、反応終了後の反応液に水を加え、一般的な抽出溶媒、例えば酢酸 エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を用いて抽出 操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒及び抽出溶 媒を留去すると、目的物が得られる。また、反応終了後、直ちに減圧加熱等の操 作により反応溶媒を留去してから同様の操作を行ってもよい。このようにして得 られる目的物は、ほぼ純粋なものであるが、晶析精製、分別蒸留、カラムクロマ トグラフィー等一般的な手法により精製を加え、さらに純度を高めてもよい。

本発明ルートAの工程(II)によって得られる、一般式(3):

20

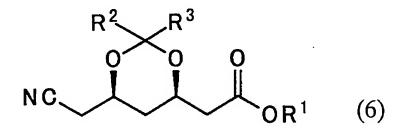
25

で表される6-シアノメチル-1,3-ジオキサン-4-酢酸誘導体において、 R^2 、 R^3 はそれぞれ独立して、水素原子、炭素数 $1 \sim 12$ のアルキル基、炭素 数6~10のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかである。 上記炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~10のアリール基、炭素数7~1 2のアラルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、1,1-ジメチルエ チル基、ヘキシル基、ドデカニル基、フェニル基、トリル基、ナフチル基、ベン ジル基、p-メトキシベンジル基、ナフチルエチル基等が挙げられる。好ましく は、メチル基である。

また、6-シアノメチル-1,3-ジオキサン-4-酢酸誘導体(3)の2つ の不斉炭素の立体配置は、使用した6-シアノ-3,5-ジヒドロキシへキサン 酸誘導体(2)の立体配置を保持しており、(3S,5R)-体、(3S,5S

WO 99/57109 PCT/JP99/02272

) -体、(3R, 5R) -体、(3R, 5S) -体の6-シアノ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体から、それぞれ、(4S, 6R) -体、(4S, 6S)
) -体、(4R, 6R) -体、(4R, 6S) -体の6-シアノメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体が得られる。好ましくは、下記一般式(6)で表される(4R, 6R) -体である。



10

15

5

従って、最も好ましい6 -シアノ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体(2)である(3 R, 5 R) -6 -シアノ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸1, 1-ジメチルエチルから、最も好ましい6 -シアノメチル-1, 3-ジオキサン -4 -m酸誘導体(3)である(4 R, 6 R) -6 -シアノメチル-2, 2-ジメチル-1, 3-ジオキサン-4 -m酸1, 1-ジメチルエチルを製造することができる。

一方、本発明ルートBの工程(III)において、アセタール形成反応剤としては、例えば、ケトン、アルデヒド、アルコキシアルカン、アルコキシアルケン等が挙げられる。上記ケトン、アルデヒド、アルコキシアルカン、アルコキシアルケンの具体例としては、例えば、アセトン、シクロヘキサノン、ホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、ジメトキシメタン、2,2-ジメトキシプロパン、2ーメトキシプロペン、1,1-ジメトキシシクロヘキサン等が挙げられる。好ましくは、アセトン、2ーメトキシプロペン、2,2ージメトキシプロパンである。より好ましくは、2,2ージメトキシプロパンである。

25 本発明ルートBの工程(III)において使用するアセタール形成反応剤の使用量は、3,5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体(1)に対し、好ましくは1~10モル当量であり、より好ましくは1~5モル当量である。また、反応を速やかに促進させる目的で、アセタール形成反応剤を反応溶媒として使用することができる。

本発明ルートBの工程(III)において、酸触媒としては、ルイス酸又はブレンステッド酸が使用できる。上記ルイス酸、ブレンステッド酸としては、例えば、三塩化アルミニウム、三フッ化ホウ素、二塩化亜鉛、四塩化スズ等のルイス酸;シュウ酸、ギ酸、酢酸、安息香酸、トリフルオロ酢酸等のカルボン酸;メタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、カンファースルホン酸、ピリジニウムpートルエンスルホン酸等のスルホン酸;塩酸、硫酸、硝酸、ホウ酸等の無機酸等が挙げられる。好ましくは、pートルエンスルホン酸、カンファースルホン酸、ピリジニウムpートルエンスルホン酸である。

本発明ルートBの工程(III)において使用する酸触媒の使用量は、3,5
10 ージヒドロキシー6ーハロヘキサン酸誘導体(1)に対し、好ましくは0.00
1~0.5モル当量であり、より好ましくは0.005~0.2モル当量である。
本発明ルートBの工程(III)の反応は、無溶媒でも実施できるが、各種有機溶媒を反応溶媒に使用してもよい。上記有機溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メチルtープチルエーテル、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒;酢酸エチル、酢酸プチル等のエステル系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム、1,1,1ートリクロロエタン等のハロゲン系溶媒;ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル等の含窒素系溶媒;ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられる。上記有機溶媒は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。好ましくは、トルエン、アセトン、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、

25 本発明ルートBの工程(III)の反応温度は、-20℃から100℃、好ましくは0℃から50℃である。

ルスルホキシド、N-メチルピロリドン等である。

ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル、ジメチ

本発明ルートBの工程(III)の反応時間は、反応条件によって異なるが、数分 ~ 10 時間である。

反応終了後、反応液から生成物を取得するためには、一般的な後処理を行えば、

よい。例えば、反応終了後の反応液に水を加え、一般的な抽出溶媒、例えば酢酸 エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を用いて抽出 操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒及び抽出溶 媒を留去すると、目的物が得られる。また、反応終了後、直ちに減圧加熱等の操 作により反応溶媒を留去してから同様の操作を行ってもよい。このようにして得 られる目的物は、ほぼ純粋なものであるが、晶析精製、分別蒸留、カラムクロマ トグラフィー等一般的な手法により精製を加え、さらに純度を高めてもよい。

本発明ルートBの工程(III)によって得られる、一般式(7);

15

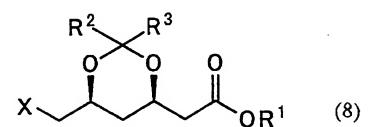
20

25

で表される6-ハロメチル-1,3-ジオキサン-4-酢酸誘導体において、R 2、R³は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数1~12のアルキル基、炭素 数6~10のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかである。 上記炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~10のアリール基又は炭素数7~ 12のアラルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、1,1-ジメチル エチル基、ヘキシル基、ドデカニル基、フェニル基、トリル基、ナフチル基、ベ ンジル基、p-メトキシペンジル基、ナフチルエチル基等が挙げられる。好まし くは、メチル基である。

また、6-ハロメチル-1、3-ジオキサン-4-酢酸誘導体(7)の2つの 不斉炭素の立体配置は、使用した3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘 導体 (1) の立体配置を保持しており、(3S, 5S) -体、(3S, 5R) -体、(3R, 5S) -体、(3R, 5R) -体の3, 5-ジヒドロキシー6-ハ ロヘキサン酸誘導体から、それぞれ、(4S,6S)-体、(4S,6R)-体、 (4R, 6S) -体、(4R, 6R) -体の6-ハロメチル-1, 3-ジオキサ ン-4-酢酸誘導体が得られる。好ましくは、下記一般式(8)で表される(4 R, 6S) - 体である。

PCT/JP99/02272



5

15

20

25

従って、最も好ましい3, 5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体(1)である(3 R, 5 S)-6-クロロ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸1, 1-ジメチルエチルから、最も好ましい6-ハロメチル-1, 3-ジオキサン-4-m酸誘導体(7)である(4 R, 6 S)-6-クロロメチル-2, 2-ジメチル-1, 3-ジオキサン-4-m酸1, 1-ジメチルエチルを製造することができる。

本発明ルートBの工程 (IV) において、シアノ化剤としては、青酸塩が使用できる。この青酸塩としては、例えば、シアン化ナトリウム、シアン化カリウム、シアン化カルシウム、シアン化銀、シアン化テトラエチルアンモニウム、シアン化テトラブチルアンモニウム等が挙げられる。好ましくはシアン化ナトリウム又はシアン化カリウムである。

本発明ルートBの工程 (IV) において使用するシアノ化剤の使用量は、6- ハロメチルー1、3-ジオキサンー4- 酢酸誘導体 (7) に対し、好ましくは $1 \sim 5$ モル当量であり、より好ましくは $1 \sim 2$ モル当量である。

本発明ルートBの工程(IV)において、使用できる溶媒として、水、又は、有機溶媒が挙げられる。上記有機溶媒として、例えば、メタノール、エタノール、ブタノール、イソプロピルアルコール、エチレングリコール、メトキシエタノール等のアルコール系溶媒;ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メチル tープチルエーテル、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム、1,1,1-トリクロロエタン等のハロゲン系溶媒;ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル等の含窒素系溶媒;ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルリン

酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられる。上記溶媒は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。好ましくは、水、ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ホルムアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン等である。

本発明ルートBの工程(IV)の反応温度は、0℃から150℃、好ましくは20℃から100℃である。

本発明ルートBの工程 (IV) の反応時間は、反応条件によって異なるが、数分 ~ 10 時間である。

反応終了後、反応液から生成物を取得するためには、一般的な後処理を行えばよい。例えば、反応終了後の反応液に水を加え、一般的な抽出溶媒、例えば酢酸エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を用いて抽出操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒及び抽出溶媒を留去すると、目的物が得られる。また、反応終了後、直ちに減圧加熱等の操作により反応溶媒を留去してから同様の操作を行ってもよい。このようにして得られる目的物は、ほぼ純粋なものであるが、晶析精製、分別蒸留、カラムクロマトグラフィー等一般的な手法により精製を加え、さらに純度を高めてもよい。

本発明ルートBの工程 (IV) によって得られる、一般式 (3);

25

で表される6-シアノメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体の2つの不 育炭素の立体配置は、使用した6-ハロメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸 誘導体(7)の立体配置を保持しており、(4S, 6S)-体、(4S, 6R) -体、(4R, 6S)-体、(4R, 6R)-体の6-ハロメチル-1, 3-ジ オキサン-4-酢酸誘導体から、それぞれ、(4S, 6R)-体、(4S, 6S))-体、(4R, 6R)-体、(4R, 6S)-体の6-シアノメチル-1, 3 -ジオキサン-4-酢酸誘導体が得られる。好ましくは、上記と同じ一般式(6) で表される(4R,6R)-体である。

従って、最も好ましい6-ハロメチル-1,3-ジオキサン-4-酢酸誘導体(7)である(4R,6S)-6-クロロメチル-2,2-ジメチル-1,3-ジオキサン-4-酢酸1,1-ジメチルエチルから、最も好ましい6-シアノメチル-1,3-ジオキサン-4-酢酸誘導体(3)である(4R,6R)-6-シアノメチル-2,2-ジメチル-1,3-ジオキサン-4-酢酸1,1-ジメチルエチルを製造することができる。

発明を実施するための最良の形態

10 以下に実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例 に制限されるものではない。

なお、以下の実施例に記載されている 1 H -核磁気共鳴スペクトル(1 H -NMR)及び 13 C -核磁気共鳴スペクトル(13 C -NMR)は、日本電子社製EX -400を用いて測定した。

15

実施例1

<u>(3R, 5R) - 6 - シアノ - 3, 5 - ジヒドロキシヘキサン酸 1, 1 - ジメチルエチルの合成</u>

(3 R, 5 S) -6-クロロ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸1, 1-ジメ 5 チルエチル(米国特許第5278313号明細書に記載の方法にて合成) 238 mg(1.0mmol)を2.0mlのジメチルホルムアミドに溶解し、シアン 化ナトリウム50mg(1.0mmol)の0.5ml水溶液を滴下した。80 で2時間撹拌後、室温に冷却し、反応液に水10mlを加え、酢酸エチルで5 回抽出した。

25 抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去した。得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselgel60、ヘキサン:酢酸エチル=50:50)により精製し、(3R,5R)-6-シアノ-3,5-ジヒドロキシヘキサン酸1,1-ジメチルエチル185mgを81%の収率で油状物として得た。

¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz/ppm); 1. 47 (9H, s), 1. 72 (2H, dd), 2. 43 (2H, dd), 2. 55 (2H, dd), 3. 96 (1H, bd), 4. 21 (1H, bt), 4. 23-4. 34 (1H, m), 4. 25 (1H, bs)

 13 C-NMR (CDCl₃, 100MHz/ppm); 25. 8, 28. 1. 40. 8, 41. 9, 67. 9, 68. 7, 82. 1, 117. 4, 172. 1

実施例2

(4R, 6R) - 6 - 97/47 + 9 - 2, 2 - 94 + 94 - 1, 3 - 94 + 94 - 944-酢酸1,1-ジメチルエチルの合成

(3R, 5R) - 6 - シアノ - 3, 5 - ジヒドロキシヘキサン酸1, 1 - ジメチルエチル229mg(1.0mmol)をアセトン1.0mlに溶解し、2、 2-ジメトキシプロパン0. 49ml(4.0mmol)、ピリジニウムp-ト ルエンスルホネート 5. 2 mg (0. 05 mm o l) を順次加え、室温で 5 時間 撹拌した。減圧下に反応溶媒と過剰の2,2-ジメトキシプロパンを留去し、残 査に水10m1を加え、酢酸エチルで3回抽出した。

抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下 に溶媒を留去した。得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(M erck社製Kieselgel60、ヘキサン:酢酸エチル=80:20) に より精製し、(4R, 6R) -6-シアノメチル-2.2-ジメチル-1.3-ジオキサンー4ー酢酸1、1ージメチルエチル229mgを白色固体として収率 85%で得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃, 400MHz/ppm); 1. 32 (1H, dd), 1. 39 (3H, s), 1. 45 (9H, s), 1. 46 (3H, s), 1. 75 (1H, dt), 2. 34 (1H, dd), 2. 46 (1H, dd), 2. 25 51 (2H, t), 4. 12-4. 17 (1H, m), 4. 26-4. 31 (1 $^{13}C-NMR$ (CDCl₃, 100MHz/ppm); 19. 6, 25. 0, 28. 1, 29. 7, 35. 4, 42. 3, 65. 1, 65. 7, 80. 9, 9 9. 5, 116. 8, 169. 9

実施例3

(4R, 6S) - 6 - クロロメチル-2, 2 - ジメチル-1, 3 - ジオキサン-4 - 酢酸1, 1 - ジメチルエチルの合成

(3R,5S)-6-クロロ-3,5-ジヒドロキシへキサン酸1,1-ジメチルエチル(米国特許第5278313号明細書に記載の方法にて合成)476mg(2.0mmol)をアセトン2.0mlに溶解し、2,2-ジメトキシプロパン0.49ml(4.0mmol)、ピリジニウムpートルエンスルホネート10.4mg(0.10mmol)を順次加え、室温で6時間撹拌した。減圧下に反応溶媒と過剰の2,2-ジメトキシプロパンを留去し、残査に水10mlを加え、酢酸エチルで3回抽出した。

抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去して(4R,6S)-6-クロロメチルー2,2-ジメチルー1,3-ジオキサン-4-酢酸1,1-ジメチルエチル510mgを収率92%で得た。

¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz/ppm); 1. 25 (1H, dd), 1. 39 (3H, s), 1. 45 (9H, s), 1. 47 (3H, s), 1. 77 (1H, dt), 2. 33 (1H, dd), 2. 46 (1H, dd), 2. 40 (1H, dd), 2. 51 (1H, dd), 4. 03-4. 10 (1H, m), 4. 25-4. 30 (1H, m)

¹³C-NMR (CDCl₃, 100MHz/ppm); 19. 7, 28. 1, 29. 8, 34. 0, 42. 6, 47. 1, 65. 9, 69. 2, 80. 8, 9 9. 3, 170. 1

25 実施例4

15

 (4R, 6R) - 6 - シアノメチルー2, 2 - ジメチルー1, 3 - ジオキサンー

 4 - 酢酸1, 1 - ジメチルエチルの合成

(4R, 6S) - 6 - クロロメチル-2, 2 - ジメチル-1, 3 - ジオキサン - 4 - 酢酸1, 1 - ジメチルエチル278.1 (1.0 mm o 1) を2.0 m1 のジメチルスルホキシドに溶解し、シアン化ナトリウム100mg (2.0mm ol)の0.5ml水溶液を滴下した。100℃で30時間撹拌後、室温に冷却し、反応液に水10mlを加え、n-ヘキサンで3回抽出した。抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去した。得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck 社 Kieselgel60、ヘキサン:酢酸エチル=80:20)により精製し、(4R,6R)-6-シアノメチル-2、2-ジメチル-1、3-ジオキサン-4-酢酸1、1-ジメチルエチル28mgを白色固体として収率11%で得た。

10 産業上の利用可能性

本発明は、上述の構成よりなるので、医薬品中間体、特に、HMG補酵素A還元酵素阻害剤アトロバスタチンの製造における重要中間体である6-シアノメチルー1,3-ジオキサンー4- 酢酸誘導体及びこれらの光学活性体を、工業的に入手容易な原料から、安価かつ高収率で製造することができる。

PCT/JP99/02272

21

請求の範囲

1. 一般式(1);

(式中、R¹は、水素原子、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~10のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。Xは、ハロゲン原子を表す。)で表される3,5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体に対して、シアノ化剤を作用させてハロゲン原子をシアノ基に置換するシアノ化反応、及び、酸触媒存在下でアセタール形成反応剤を用いるジオールのアセタール形成反応を行うことを特徴とする、一般式(3);

(式中、 R^1 は、前記に同じ。 R^2 , R^3 は、それぞれ独立して、水素原子、炭 素数 $1 \sim 1$ 2 のアルキル基、炭素数 $6 \sim 1$ 0 のアリール基又は炭素数 $7 \sim 1$ 2 の アラルキル基のいずれかを表す。)で表される 6 -シアノメチル-1, 3 -ジオキサン-4 - 酢酸誘導体の製造方法。

2. 一般式(1)で表される3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導 25 体と、シアノ化剤との反応により、一般式(2);

$$NC$$

$$OH OH O$$

$$OR^1 (2)$$

WO 99/57109 PCT/JP99/02272

5

3. 一般式(1)で表される化合物として、一般式(4);

$$X \xrightarrow{OH OH O} OR^1$$
 (4)

10

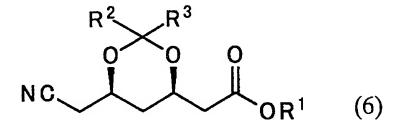
(式中、 R^1 は、水素原子、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 0 のアリール基又は炭素数 $7\sim 1$ 2 のアラルキル基のいずれかを表す。X は、ハロゲン原子を表す。)で表される(3 R, 5 S) -3, 5 -ジ ヒドロキシー6 - ハロヘキサン酸誘導体を使用して、これとシアノ化剤との反応により、- 般式(5):

15

$$NC \xrightarrow{OH OH O} OR^1 \qquad (5)$$

(式中、 R^1 は、前記に同じ。)で表される(3R, 5R)-6ーシアノー3,

20 5 - ジヒドロキシヘキサン酸誘導体を得た後に、酸触媒条件下、アセタール形成 反応剤によりアセタール形成反応を行うことにより、一般式 (6):



25

(式中、 R^1 は、前記に同じ。 R^2 , R^3 は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数 $1\sim1$ 2 のアルキル基、炭素数 $6\sim1$ 0 のアリール基又は炭素数 $7\sim1$ 2 のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される(4R, 6R) -6 - シアノメチ

ルー1,3ージオキサンー4ー酢酸誘導体を得る請求項2記載の製造方法。

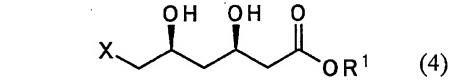
4. 一般式(1)で表される3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体を、酸触媒条件下、アセタール形成反応剤によりアセタール形成反応を行い、5 一般式(7);

10

20

(式中、 R^1 は、水素原子、炭素数 $1\sim 12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 10$ のアリール基又は炭素数 $7\sim 12$ のアラルキル基のいずれかを表す。Xは、ハロゲン原子を表す。 R^2 , R^3 は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数 $1\sim 12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 10$ のアリール基又は炭素数 $7\sim 12$ のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される6-ハロメチル-1, 3-ジオキサン-4-酢酸誘導体を得た後に、シアノ化剤によりシアノ化する請求項1記載の製造方法。

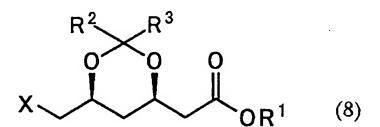
5. 一般式(1)で表される化合物として、一般式(4):



(式中、R¹は、水素原子、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~10のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。Xは、ハロゲン原子を表す。)で表される(3R,5S)-3,5-ジヒドロキシ-6-ハロヘキサン酸誘導体を使用して、酸触媒条件下、アセタール形成反応剤によりアセタール形成反応を行い、一般式(8);

PCT/JP99/02272

WO 99/57109



24

10 化することにより、一般式(6);

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & R^3 \\
0 & 0 \\
0 & 0 \\
0 & 0
\end{array}$$

$$OR^1 \qquad (6)$$

15

5

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は、前記に同じ。)で表される(4R, 6R) -6-シアノメチルー1, 3-ジオキサンー4-酢酸誘導体を得る請求項4記載の製造方法。

20 6. 一般式(1);

$$X \longrightarrow OH OH O$$

$$OR^1 \qquad (1)$$

25 (式中、R¹は、水素原子、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~10のア リール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表し。Xは、ハロゲン 原子を表す。)で表される3,5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体に、 シアノ化剤を反応させることを特徴とする、一般式(2):

$$NC$$

$$OH OH O$$

$$OR^1$$
(2)

- 5 (式中、 R^1 は、前記に同じ。)で表される6-シアノ-3, 5-ジヒドロキシ ヘキサン酸誘導体の製造方法。
 - 7. 一般式(1)で表される化合物として、一般式(4);

$$X \xrightarrow{OH OH O} OR^1 \qquad (4)$$

(式中、 R^1 は、水素原子、炭素数 $1\sim 12$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 10$ のアリール基又は炭素数 $7\sim 12$ のアラルキル基のいずれかを表す。 Xは、ハロゲン原子を表す。)で表される(3R, 5S) -3, 5-ジヒドロキシー6-ハロヘキサン酸誘導体を使用して、これにシアノ化剤を反応させることにより、一般式(5);

(式中、 R^1 は、前記に同じ。)で表される(3R, 5R) -6-シアノ-3, 5-ジヒドロキシヘキサン酸誘導体を得る請求項6記載の製造方法。

- 8. R 2 及び R 3 がいずれもメチル基である請求の範囲第 $1\sim5$ 項に記載の製造方法。
 - 9. アセタール形成反応剤として2,2-ジメトキシプロパンを使用する請求の範囲第8項に記載の製造方法。

10. 酸触媒は、p-トルエンスルホン酸、カンファースルホン酸又はピリジニウムp-トルエンスルホン酸である請求の範囲第1~5、8又は9項記載の製造方法。

5

- 11. Xが塩素原子である請求の範囲第1~10項に記載の製造方法。
- 12. R 1 が 1 , 1- ジメチルエチル基である請求の範囲第 $1\sim 1$ 1 項に記載の製造方法。

10

13. シアノ化剤がシアン化ナトリウム又はシアン化カリウムである請求の範囲第1~12項に記載の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/02272

A. CLASSI Int.(FICATION OF SUBJECT MATTER C1 C07D319/06, C07C253/14, C0	7C255/20 // C07B61/00,	300			
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ C07D319/00-24						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)						
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y A	JP, 6-502162, A (Warner-Lamb 10 March, 1994 (10. 03. 94), Particularly refer to Claim 1 & US, 5103024, A & CA, 2092 & WO, 92/06968, A1 & EP, 55 & HU, 64049, A2 & ES, 20705 & US, 5248793, A & NO, 9301	l 2997, AA 53213, A1 519, T3	1, 4-5, 8-13 2-3, 6-7			
Y A	US, 5278313, A (E.R. Squibb 11 January, 1994 (11. 01. 94) Refer to Claims; Examples 1 & US, 5457227, A & US, 5594), (c)-(d), 4(b)-(c)	1, 4-5, 8-13 2-3, 6-7			
A	JP, 7-500105, A (Warner-Lamb 5 January, 1995 (05. 01. 95) Reference as a whole & US, 5155251, A & WO, 93/0 & EP, 643689, A1 & ES, 2129 & FI, 9401632, A & NO, 940	, 07115, Al 9457, T3	1-13			
X Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u> </u>			
Special categories of cited documents: A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"Y" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 31 August, 1999 (31.08.99)				
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer				
Japanese Patent Office						
Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/02272

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/02272

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl. CO7D319/06, CO7C253/14, CO7C255/20, // CO7B61/00, 300						
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int.Cl. CO7D319/00-24						
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの						
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS (STN) , REG I STRY (STN)						
C. 関連すると認められる文献	****	DB) of Jan.				
引用文献の	・まは、その関連する簡所の表示	関連する 請求の範囲の番号				
Y JP,6-502162,A (Warner-Lambert Co. A 10.3.1994 (10.03.94) 特に、特許) 	1, 4-5, 8-13 2-3, 6-7				
Y US, 5278313, A(E.R. Squibb & Sons, I 11. 1. 1994(11. 01. 94) 特許請求の範囲、及び実施例 1(c)- &US, 5457227, A &US, 5594153,	(d), 実施例 4 (b)-(c) を参照	1, 4-5, 8-13 2-3, 6-7				
X C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。				
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に督及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 24.08.99	国際調査報告の発送日 31.08.99					
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 内田 淳子 15 電話番号 03-3581-1101					

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/02272

			<u></u>	
C (続き).	関連すると認められる文献			明本ナス
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部	8の箇所が関連するとき1	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP,7-500105,A (Warne 5.1.1995 (05.01.95) &US,5155251,A &ES,2129457,T3	r-Lambert Co.) 文献全体 &WO,93/07115,Al &FI,9401632,A	&EP, 643689, A1 &NO, 9401280, A	1-13
A	WO, 97/00968, A1 (Zene 9.1.1997 (09.01.97) &CA, 2221800, AA	ca Ltd.) 文献全体 &EP,833938,A1	&JP, 11-507204, A	1-13
A		&EP, 833938, A1 r-Lambert Co.)	&CA, 1330441, A1 &ES, 2058356, T3 &US, 5097045, A &US, 5216174, A &FI, 9401550, A &NO, 9501075, A	1-13
			·	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.